07;12 Фоторазложение гексахлорбифенила излучением KrCl (222 nm) эксилампы барьерного разряда

© А.А. Пикулев, В.М. Цветков

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров E-mail: pikulev@expd.vniief.ru

Поступило в Редакцию 29 мая 2009 г.

Проведено исследование дехлорирования 2, 2', 4, 4', 5, 5'-гексахлорбифенила (ПХБ № 153) при воздействии УФ-излучения KrCl* (222 nm) эксилампы барьерного разряда. Был исследован фотолиз трех образцов: № 1 — раствор ПХБ № 153 в гексане с концентрацией 10 µg/ml; № 2 — то же с концентрацией 1 µg/ml; № 3 — пленка ПХБ № 153 на кварцевой пластинке. Степень разложения ПХБ № 153 определялась по спектрам пропускания образцов в диапазоне 185–350 nm. Анализ спектров поглощения свидетельствует, что в первую очередь происходит отделение атомов хлора в ортоположениях (2, 2'). При интенсивности УФ-излучения на поверхности образцов 3 mW/cm² остаточное содержание ПХБ № 153 составляет: для образца № 1 — менее 2% после 60 min облучения; № 2 — < 3% после 25 min облучения; № 3 — < 20% после 60 min облучения.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) являются одним из сильных загрязнителей окружающей среды. ПХБ наряду с ДДТ, алдрином, хлорданом, полихлорированными дибензо-п-диоксинами и другими входят в список 12 самых токсичных соединений [1].

В силу своих уникальных физико-химических свойств ПХБ нашли самое широкое применение во всех развитых странах в качестве диэлектриков в высоковольтных трансформаторах и конденсаторах [1,2].

В настоящее время производство ПХБ остановлено, а использование его в старом оборудовании ограничено. С начала 1929 г. до прекращения промышленного выпуска в 1986 г. в мире (в России в 1993 г.) было произведено около 2 млн. тонн ПХБ. Общий объем ПХБ, находящийся на территории России, оценивается в 30 тыс. тонн [1].

97

ПХБ относятся к классу ароматических соединений, состоящих из двух бензольных колец и содержащих от одного до десяти атомов хлора, количество и положение которых определяет структуру конкретной молекулы ПХБ (конгенер). Всего существует 209 конгенеров ПХБ, общая формула которых имеет вид $C_{12}H_{10-n}Cl_n$, где n = 1-10; реальную опасность для здоровья человека представляют 12 конгенеров [1,2].

На данный момент разработаны следующие методы обезвреживания ПХБ: реагентные, электрохимические, пиролитические, биотехнологические, окислительные, радиационные и фотохимические [3]. Однако лишь некоторые из этих технологий способны удовлеворять стандарту, принятому за рубежом. В частности, согласно нормативам, установленным Агентством по охране окружающей среды в США, степень деструкции ПХБ должна составлять не меее 99.9999% [1,3].

Одним из перспективных методов разложения ПХБ является УФ-фотолиз, который обладает высокой избирательностью, эффективностью и экологичностью [4,5]. УФ-фотолиз может быть использован для разложения высокохлорированных конгенеров ПХБ, для которых реагентные и биотехнологические методы разложения неэффективны [6].

Высокая избирательность и эффективность УФ-фотолиза связана с тем, что при облучении молекулы ПХБ светом с длиной волны 250–300 nm происходит селективное возбуждение синглетного состояния. Далее возбуждение путем интеркомбинационной конверсии передается на триплетное состояние, через которое идет процесс разложения молекулы ПХБ в реакциях дехлорирования и замещения атомов хлора [7].

В спектрах поглощения ПХБ имеется три полосы: главная полоса (200–225 nm), *к*-полоса (245–265 nm) и слабая полоса поглощения 220–240 nm. Главная полоса поглощения присутствует у всех конгенеров и соответствует переходу $S_0 \rightarrow S_2$ в фенильном кольце. В неортозамещенных и монозамещенных ПХБ наблюдается также *к*-полоса, которая приписывается сопряжению между фенильными кольцами и вызвана переходом $S_0 \rightarrow S_1$. *к*-полоса существует у более чем 50 конгенеров, а промежуточная полоса 220–240 nm наблюдается только для ПХБ № 63, 74, 81 и 114 (по классификации ИЮПАК).

Все три типа спектров поглощения ПХБ представлены на рис. 1 [8].

В экспериментах по фоторазложению ПХБ обычно используется УФ-излучение следующих источников: 1) ртутная лампа низкого (254 nm) и среднего давления [9]; 2) ксеноновая лампа высокого давления (250–300 nm) [10]; 3) солнечный свет (> 280 nm) [11].



Рис. 1. Спектры поглощения 2, 2', 4, 4', 5' — ПентаХБ (ПХБ № 99) (*1*): 3, 3', 4, 4', 5 — ПентаХБ (ПХБ № 126) (*2*): 2, 3, 4', 5 — ТетраХБ (ПХБ № 63) (*3*); спектр излучения KrCl^{*} — эксилампы (*4*).

К настоящему моменту в дополнение к ртутной и ксеноновой лампевспышке добавились источники спонтанного УФ-излучения нового поколения — эксилампы, излучение в которых происходит на переходах эксимеров инертных газов и эксиплексов (возбужденные состояния соединений атомов инертных газов с галогенами) [12].

Так, с помощью KrCl* (222 nm) и XeCl* (308 nm) эксиламп барьерного разряда было изучено фоторазложение полихлорированных дибензо-*n*-диоксинов [13]; Xe₂* (172 nm) эксилампа была использована для очистки воды от органических микрозагрязнителей [14] и фотоминерализации метанола [15]; в работе [16] для УФ-фотолиза водных растворов хлорфенолов использовалась XeBr* (283 nm) эксилампа.

В настоящей работе для исследования фотолиза ПХБ была использована KrCl* (222 nm) эксилампа барьерного разряда. Лампа представляет собой две коаксиальные кварцевые (КУ-2) трубки, вставленные одна в другую; длина и наружный диаметр лампы составляют 330 и 43 mm соответственно. Двухполярные импульсы напряжения (частота 100 kHz,

амплитуда $3 \, kV$) подавались на сеточные электроды, закрепленные на внутренней и наружной поверхности лампы. При работе эксилампы осуществлялось внешнее и внутреннее воздушное охлаждение.

Лампа заполнялась смесью Kr/Cl₂ (350:1) при давлении 205 Torr. В спектре излучения эксилампы в диапазоне 180–280 nm наблюдаются сильный переход $B \rightarrow X$ (222 nm) и более слабый переход $D \rightarrow A$ (235 nm) эксиплекса KrCl*, а также небольшой пик излучения перехода $D' \rightarrow A'$ (258 nm) эксимера Cl₂^{*}. Ширина спектральной линии излучения 222 nm на полувысоте составляет около 3 nm (см. рис. 1).

Для изучения воздействия УФ-излучения KrCl* (222 nm) эксилампы барьерного разряда на ПХБ был выбран маркерный конгенер 2, 2′, 4, 4′, 5, 5′-ГексаХБ (ПХБ № 153 по классификации ИЮПАК), содержащий шесть атомов хлора.

Был исследован фотолиз трех образцов ПХБ № 153 (производство фирмы "Sigma—Aldrich Chemistry"): 1) раствор ПХБ № 153 в гексане с концентрацией 10 mg/ml; 2) то же с концентрацией 1µg/ml; 3) пленка ПХБ № 153 на кварцевой пластинке. Параллельно с облучением растворов (образцы № 1, 2) проводилось облучение чистого гексана. Облучение образцов № 1, 2 и гексана проводилось в плоских кварцевых кюветах, при этом толщина слоя раствора во всех случаях составляла 1 mm. Пленка ПХБ № 153 на кварцевом стекле создавалась следующим образом: сначала на поверхность стекла был нанесен тонкий слой раствора ПХБ в гексане с концентрацией 10µg/ml, после чего в течение 2 h производилось высушивание образовавшейся пленки в герметичной кювете при постоянной откачке форвакуумным насосом.

Подготовленные образцы помещались на расстоянии 1 ст от поверхности эксилампы. Интенсивность УФ-излучения на поверхности образцов составляла 3 mW/cm². Образцы № 1 и 3 облучались в течение 60 min; спектры пропускания определялись в промежутки времени 0, 20, 40 и 60 min от начала облучения. Образец № 2 облучался в течение 25 min; спектры определялись в моменты времени 0, 10, 15 и 25 min. Для определения спектров пропускания облученных образцов использовался спектрофотометр SPECORD M 40.

Спектры поглощения образца № 2 в зависимости от времени облучения приведены на рис. 2. Спектр поглощения необлученного раствора ПХБ № 153, как у большинства ортозамещенных конгенеров, имеет главную полосу поглощения (200–225 nm), полку в области *к*-полосы (240–255 nm) и небольшой пик поглощения в области 280–290 nm.



Рис. 2. Спектр поглощения образца № 2 в зависимости от времени облучения: без облучения (*I*); 10 min (*2*); 15 min (*3*); 25 min (*4*) (начальная концентрация ПХБ № 153 в гексане $1 \mu g/ml$).

Из рис. 2 видно, что через 10 min после начала облучения спектр поглощения раствора принимает вид типичного спектра поглощения неортозамещенных конгенеров ПХБ. При этом наблюдается уменьшение коэффициента поглощения в главной полосе и возникновение пика поглощения в спектральной области 240–255 nm (*к*-полоса). При дальнейшем облучении происходит уменьшение коэффициента поглощения раствора во всем спектральном диапазоне 180–350 nm и сдвиг *к*-полосы в коротковолновую область. После 25 min облучения спектр поглощения по форме близок к спектрам поглощения бифенила и низкохлорированных неортозамещенных конгенеров ПХБ [8].

Полученные результаты можно объяснить, если предположить, что при УФ-облучении в первую очередь происходит отрыв атомов хлора, находящихся в ортоположениях (2, 2'), что приводит к наблюдаемому изменению спектра поглощения.

Процесс дехлорирования ПХБ № 153 представлен на рис. 3 [7]. При поглощении кванта света ПХБ переходит из основного состояния в



Рис. 3. Дехлорирование ПХБ № 153 при УФ-облучении [7] (показан процесс удаления атома хлора в 2-ортоположении).

возбужденное синглетное состояние, которое, путем интеркомбинационной конверсии с квантовым выходом, близким к единице, переходит в триплетное состояние. Триплетное состояние или тушится в основное или приводит к процессам дехлорирования. Отрыв атомов хлора в ортоположениях облегчается дополнительным напряжением связи между бензольными кольцами (стерический эффект), поэтому данный фотопроцесс имеет максимальный квантовый выход [7].

Остаточное содержание ПХБ № 153 в образце (ε) в зависимости от времени облучения (τ) определялось из спектров пропускания по следующей формуле:

$$\varepsilon(\tau) = \min_{\lambda \in [\lambda_1, \lambda_2]} \{ \ln T_{\lambda}(\tau) - \ln T_{\lambda}(0) \},$$
(1)

где $[\lambda_1, \lambda_2]$ — спектральный диапазон измерений (180—350 nm); $T_{\lambda}(\tau)$ — спектральный коэффициент пропускания образца в зависимости от времени облучения.

Формула (1) получена в предположении, что поглощение образца связано исключительно с присутствием 2, 2', 4, 4', 5, 5'-ГексаХБ, поэтому дает завышенное значение остаточного содержания ПХБ № 153.

Результаты расчетов по формуле (1) показывают, что в случае образца № 1 остаточное содержание ПХБ № 153 через 20 min облучения составило менее 13%, через 40 min — < 6%, а через 60 min — < 2%. Для образца № 2 эти значения составляют: 10 min — < 11%; 15 min — < 7%; 25 min — < 3%.

Для образца № 3 степень разложения ПХБ № 153 оказалась существенно ниже, чем в случае растворов. Так, при облучении в течение 20 min остаточное содержание ПХБ № 153 составило менее 50%, через 40 min — < 30%, а через 60 min — < 20%.

Оценки показывают, что для растворов ПХБ № 153 квантовая эффективность процесса дехлорирования не ниже 1%; в случае пленки ПХБ № 153 на кварцевом стекле квантовая эффективность составляет не менее 0.1%. Первое значение хорошо коррелирует с квантовой эффективностью дехлорирования ортозамещенных конгенеров ПХБ, полученной в работе [7]. В частности, при облучении длиной волны 300 nm раствора 2, 2', 5, 5'-ТетраХБ (ПХБ № 52) в циклогексане 98% разложение было достигнуто после облучения в 20 h, а квантовая эффективность процесса составила около 1% [7].

Проведенные исследования показали достаточно высокую эффективность использования УФ-излучения KrCl*-эксилампы барьерного разряда для фоторазложения растворов высокохлорированных конгенеров ПХБ, что, вкупе с высоким кпд (10-12%) и интенсивностью УФ-излучения (10-20 mW/cm²), свидетельствует о перспективности использования KrCl*-эксилампы в промышленных фотореакторах, предназначенных для разложения ПХБ.

Настоящая работа выполнена при частичной поддержке проекта МНТЦ (№ 3583 р).

Список литературы

- [1] Клюев Н.А., Курляндский Б.А., Ревич Б.А. Диоксины в России. М.: ЮНЕП, 2001. 212 с.
- [2] Федоров Л.А. Диоксиды как экологическая опасность: ретроспектива и перспективы. М.: Наука, 1993. 266 с.

- [3] Занавескин Л.Н., Аверьянов В.А. // Успехи химии. 1998. Т. 67. № 8. С. 788-800.
- [4] Yao Y., Kakimoto K., Ogawa H.I., Kato Y., Hanada Y., Shinohara R., Yoshino E. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1997. V. 59. P. 238–245.
- [5] Koshioka M., Kanazawa J., Murai T. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1987.
 V. 38. P. 409–415.
- [6] Abramowicz D.A. // Crit. Rev. Biotechnol. 1990. V. 10. P. 241-251.
- [7] Ruzo L.O., Zabik M.K., Schuetz R.D. // J. of American Chem. Soc. 1974. V. 96. N 12. P. 3809–3813.
- [8] Andersson P.L., Haglund P., Tysklind M. // Fresenius J. Anak. Chem. 1997. V. 357. P. 1088–1092.
- [9] Yao Y., Kakimoto K., Ogawa H.I., Kato Y., Hanada Y., Shinohara R., Yoshino E. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1997. V. 59. P. 238–245.
- [10] Koshioka M., Kanazawa J., Murai T. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1987.
 V. 38. P. 409–415.
- [11] Crossby D.G., Moilanen K.W. // Bull. Environ. Contam. Taxicol. 1973. V. 10. P. 372–377.
- [12] Xu X. // Thin Solid Films. 2001. V. 390. P. 237-242.
- [13] Nohr R.S., Mac Donald J.G., Kogelschatz U., Mark G., Schuchmann H.-P., von Sonntag C. // J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 1994. V. 79. P. 141–149.
- [14] Oppenländer T., Gliese S. // Chemosphere. 2000. V. 40. P. 15–21.
- [15] Соснин Э.А., Ерофеев М.В., Тарасенко В.Ф. // Известия вузов. Физика. 2006. № 10. С. 95–97.
- [16] Матафанова Г.Г., Батоев В.Б., Соснин Э.А., Christofi N. // Химия в интересах устойчивого развития. 2008. Т. 16. № 2. С. 191–197.